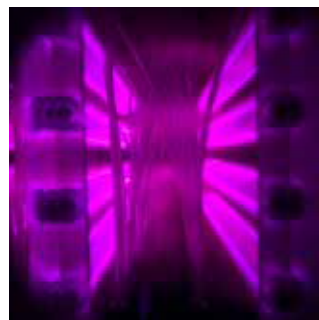


VacuTEC- 客制化真空腔体等离子设备

产品特征:

- 安装及使用简单
- 处理速度快
- 标准或客制化的处理仓
- 真空度
- 工艺气体
- 进程控制
- 节约成本
- 真空压力下等离子处理
- 独特设计的仓门



Tantec的VacuTEC等离子处理设备可配置一个或多个托盘，用于处理各种不同材料的零部件表面。该设备处理速度快，可使涂料、涂胶、涂漆及印刷等的粘合特性达到最佳的效果。

当真空处理仓内的压强为2至12mbar,接近真空时，通过等离子电极发生的放电离子作用到物体表面，对其进行处理。处理的周期一般很短，根据产品材质不同，时间在2-120s之间。

VacuTEC操作简单、可靠性强、处理速度快。处理过程中采用的工艺气体也可以是氩气、氧气等气体，但是大多数情况下，因为采用常规的空气也可以产生强大的能量，无需使用这些工艺气体，就可以达到满意的处理效果。

Tantec采用先进的HV-X系列放电发生器，配备的变压器也是根据等离子体的电极而专门设计的。

Head Office

Tantec A/S
Industrivej 6
DK-6640 Lunderskov
(+45) 7558 5822

Mail:
sales@tantec.com

Web:
www.tantec.com
www.china-tantec.com (中文)

中国区总代:
昆山市坦钛等离子科技有限公司

Tel:
0512-50333890

Mobile:
13862667395

Mail:
sales@china-tantec.com

特点：

- 安装及使用简单 连接电源和压缩空气装置
- 处理速度快 根据材料性质以及功率不同，处理时间为20-180s。
- 标准或定制化的处理仓 处理仓和托盘可根据不同应用进行设计。
- 真空度 根据应用不同，在1-12mbar条件下可产生等离子放电。
- 工艺气体 可使用氧气和氩气等工艺气体，但是大部分情况下是没必要的。
- 进程控制 等离子处理进程由HV-X系列放电发生器和PLC装置控制。所有参数在触摸板上均有显示（标准-Proface触摸屏）。
- 节约成本 功率消耗低，无需工艺气体，成本低，是改善物体表面湿润性和粘合性的最佳解决方案。
- 真空压力下等离子处理 可处理导电和非导电的物体表面。
- 独特设计的仓门 标准的仓门可手动或自动打开。

技术规格	真空等离子处理设备
电源电压和频率	100-480 VAC 50/60 Hz
输出电压/等离子功率	Max. 400 Vp/max. 2000 Watt
电源供应	HV-X系列等离子放电发生器
压缩空气入口	5-6 bar, 干燥且清洁
工艺气体	标准：根据要求，可使用大气、氧气、氩气、氮气
真空泵流量(单位:立方米/分)	15-240立方米/分, 根据真空仓的大小，也可根据客户需求订制。
真空度	1-12 mbar
排气时间, 常规	15-60s, 根据真空仓的尺寸以及泵的流量
等离子处理时间, 常规	120-180s, 根据材质
控制和连接	包括触控面板（标准-Proface）。
遵循法规	CE - RoHs - WEEE